

光刻机系列

Mask Aligner

URE系列

中国科学院微电子研究所设备

中国科学院光电技术研究所设备



主要技术与性能指标

URE-2000 系列深度光刻机

- 分辨力：0.8—1 μm
- 套刻精度：0.5 μm
- 曝光面积：1—6 英寸
- 可添加纳米压印接口

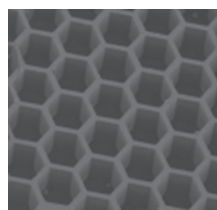
URE-2000S 双面光刻机系列

- 单面对准精度：0.5 μm
- 分辨力：1 μm
- 双面对准精度：0.5—1 μm
- 曝光面积：1—8 英寸
- 曝光方式：底面对准或双曝光头方式
- 可添加纳米压印接口

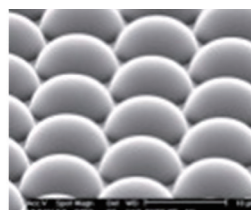
主要应用

集成电路、半导体元件、光电子器件、光学器件的研制和生产

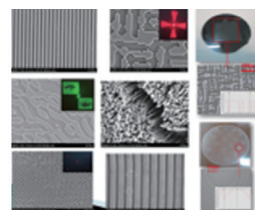
代表性应用成果



高深宽比结构



高分辨力结构



连续面形 3D 结构

主要用户单位	清华大学、北京大学、中国科学技术大学、复旦大学、浙江大学、上海交通大学、香港科技大学、南洋理工学院等高校，中国科学院物理研究所、西安光学精密机械研究所、微电子研究所、上海微系统与信息技术研究所、上海技术物理研究所、长春光学精密机械与物理研究所，以及中国电子科技集团、中国航天科技集团公司第九研究院和第四研究院等单位		
研制单位	中国科学院光电技术研究所、中国科学院微电子研究所		
联系方式	赵立新 028-85101784, 13568853630 何 萌 010-62049399, 13581817539	zhaolixin@ioe.ac.cn hemeng@ime.ac.cn	